

Directed growth of electroactive metal-organic framework thin films using electrophoretic deposition.

Autorzy

Idan Hod
Wojciech Bury
David M. Karlin
Pravas Deria
Chung-Wei Kung
Michael J. Katz
Monica So
Benjamin Klahr
Danni Jin
Yip-Wan Chung
Teri W. Odom
Omar K. Farha
Joseph T. Hupp

Rok wydania

2014

Czasopismo

Advanced Materials

Numer woluminu

26

Strony

6295-6300

DOI

10.1002/adma.201401940

Streszczenie

Electrophoretic deposition (EPD) is used to assemble metal-organic framework (MOF) materials in nano- and micro-particulate, thin-film form. The flexibility of the method is demonstrated by the successful deposition of 4 types of MOFs: NU-1000, UiO-66, HKUST-1, and Al-MIL-53. Additionally, EPD is used to pattern the growth of NU-1000 thin films that exhibit full electrochemical activity.

Słowa kluczowe

metal organic frameworks, electrophoretic deposition, thin films, electrochemical

Adres publiczny

<http://dx.doi.org/10.1002/adma.201401940>

Strona internetowa wydawcy

onlinelibrary.wiley.com

Kolekcja

Naukowa

Język

Angielski

Typ publikacji

Artykuł

Plik został wygenerowany dnia 2026-04-24 07:33:31

Adres w repozytorium <https://old.chem.uni.wroc.pl/pl/repozytorium/z11Q9Ua>.